

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成19年7月12日(2007.7.12)

【公開番号】特開2005-347426(P2005-347426A)

【公開日】平成17年12月15日(2005.12.15)

【年通号数】公開・登録公報2005-049

【出願番号】特願2004-163892(P2004-163892)

【国際特許分類】

H 01 L 21/205 (2006.01)

C 23 C 16/50 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/205

C 23 C 16/50

【手続補正書】

【提出日】平成19年5月30日(2007.5.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0056

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0056】

ここで、図4(a)は、図1や図2に示す板状電極(円筒状電極)12を示したものであり、垂直吹き付けガス流のガス流れ方向中心軸20から等距離に位置するように1枚の連続した円筒状電極12が設けられている。

図4(a)に示す例は、垂直吹き付けガス流のガス流れ方向中心軸20から等距離に放電面が位置しており、理想的な電極形状ではある。しかし、半導体製造装置のメンテナンス性の向上や、装置構造の簡素化等、実用的な面も考慮した場合、図4(b)(c)に示すように、1枚の連続した円筒状電極を4つの部分に分割(電極33a、33b、33c、33d)したものであってもよく、放電面が平坦な電極(電極34a、34b、34c、34d)を4つ用いたものであってもよい。

この場合、4つの電極の各々に図1や図2に示されるようなアース配線が接続されたアース電極が電極の外周側に配置されると共に、RF(高周波)導入端子が接続される。